

第12回実務修習に係る各課程のスケジュール(案)

		平成29年		平成30年												平成31年												平成32年			
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
実務に関する講義	期	第12回 1年コース												第13回 1年コース																	
	期	第12回 2年コース																													
改正案年	改正案1	平成29年12月1日 ~ 平成30年3月31日												【改正後講義科目】1年コース・2年コース共通 ・倫理・行政法規・ガイドライン・統計・登記・税金・建築 ・更地・借地権と底地・賃家・区分・地代・家賃・宅地見込地 ・収益還元法・原価法及び開発法 ※ 全科目につき確認テスト実施 (計16科目)																	
	改正案2	平成29年12月1日 ~ 平成30年10月31日																													
現行	現行	・倫理・収益・開発法・建築・更地 (計)5科目												・登記・税金・統計・賃家・地代・家賃・借地権と底地・区分 (計)8科目																	
	現行																														
基本演習	改正案1	第一段階1日目において、「依頼の受付方法・確認書等の取得に関する解説」を行う。												① 更地【3日】 ② 借地権底地【2日】 ③ 自建・賃家【3日】 ④ 継続賃料【2日】																	
	改正案2													① 更地【3日】 ② 借地権底地【2日】 ③ 自建・賃家【3日】 ④ 継続賃料【2日】																	
現行	現行	① 更地【2日】												② 賃家【2日】																	
	現行																														
1年改正案	1年改正案	【物件調査】・土地・建物 ・住宅地・商業地・大規模画地・底地 (計)4件 >再履修												【一般実地演習・2回目報告】 ・低層住宅地・業務用ビル・居住用賃貸・オフィス用賃貸・借地権付建物(住宅地) or 借地権付建物(商業地) (計)5件																	
	2年改正案	【物件調査】・土地・建物 ・住宅地・商業地 (計)2件 >再履修												【一般実地演習・2回目報告】 ・大規模画地・底地・宅地見込地等 or 工業地・低層住宅 (計)4件																	
1年現行	1年現行	物件調査 ・住宅地・商業地・工業地・大規模画地・建付地 (計)5件												借地権・底地・宅地見込地・低層住宅・店舗・業務用ビル・居住用賃貸・店舗用賃貸・オフィス用賃貸 (計)9件																	
	2年現行	【物件調査】・土地・建物 ・住宅地・商業地 (計)2件 >再履修												【一般実地演習・3回目報告】 ・業務用ビル・居住用賃貸・オフィス用ビル (計)3件																	
2年改正案	2年改正案	【物件調査】・土地・建物 ・住宅地・商業地 (計)2件 >再履修												【一般実地演習・3回目報告】 ・業務用ビル・居住用賃貸・オフィス用ビル (計)3件																	
	2年現行	物件調査(土地・建物)												・大規模画地・借地権・底地 (計)3件																	
2年現行	2年現行	物件調査(土地・建物)												・大規模画地・店舗・業務用ビル・居住用賃貸 (計)5件																	
	2年現行	物件調査(土地・建物)												・店舗用賃貸・高度利用賃貸・オフィス用賃貸・マンション・事務所・店舗ビル (計)5件																	
修正案	修正案	記述の考査(会場実施) + 口述の考査(会場実施)												【再受験①】 対象者: 不合格のうち基準に達した者 内容等: 不合格が通知された日から2ヶ月以内(4~5月頃)に、口述の考査のみ実施のうえ、可否決定する。 【再受験②】 対象者: 不合格のうち基準に満たなかった者 及び 上記再受験①の不合格者 内容等: 次回の修正考査(1年後)を受験(ただし、再履修(指定された複数類型に係る鑑定評価書等の作成)が必要)																	
	修正案	記述の考査(会場実施) + 口述の考査(会場実施)												記述の考査(会場実施) + 口述の考査(会場実施)																	
現行	現行	記述の考査(会場実施) + 口述の考査(会場実施)												記述の考査(会場実施) + 口述の考査(会場実施)																	
	現行	記述の考査(会場実施) + 口述の考査(会場実施)												記述の考査(会場実施) + 口述の考査(会場実施)																	